가

•

1.				AOP				
	(1) UV		: UV	, UV + H ₂ O ₂ , U	$V + O_3, UV + 0$	O₃ + H₂O	2	
			contin	uous LP, MP me	rcury lamp sys	tem vs. p	oulsed krypton	
			lamp s	system				
	(2) O ₃		: O ₃	, O ₃ + H ₂ O ₂ , O ₃ -	+ UV, O ₃ + UV	+ H ₂ O ₂		
			convent	tional O ₃ generat	or vs. microbu	bble O ₃ (generator	
2.	flash UV system							
3.	AOP/							
4.								
1. UV+	H_2O_2							
-	H	2 O 2		가				
- UV			가	가 가	UV			
5	AMX	PG	가	TC	가			
- UV+H ₂ O ₂ 1						55 ~		
66%, 3			80~85%	5가 .				

,

가

"

,,

•

•

- UV+H₂O₂

1

.

,

,

.

,

2.

 UV
 AMX
 가 가
 가 가
 SDM

 . UV+H2O2
 (kuh)
 PG가 가
 AMP가 가
 5

 k
 . UV
 (ku)
 (kuh)
 (kuh)
 5

 0.0031
 0.1123
 . AMX
 ku/kuh
 가 72.6%
 UV

 ,
 SDM
 1.9%
 .
 .

3. H₂O₂

4. pH

 TC
 1
 55~60%, 3
 80%
 pH

 .
 UV+H2O2
 TC
 pH
 5~8
 pH

-

.

•

가 가

1		1
1.		
1.		5
2		7
1.		9
2.		19
2.		21
3		33
1.		35
2.		35
3.		37
4		45
1.	UV+H ₂ O ₂	47
2.		52
3.	H_2O_2	59
4.	рН	60
5		63
1.		65
2.		65
6		